

# SISTEMA DE CONTROL DE INSUMOS PARA CULTIVOS FIELD-IQ

Aumente el rendimiento y ahorre dinero al sembrar, pulverizar, aplicar o fertilizar. Ajuste la dosis manualmente o use las prescripciones de una pantalla Trimble® para variar la dosis automáticamente.

## CONTROL DE APLICACIÓN DE DOSIS VARIABLE



- Controle simultáneamente la dosis de aplicación de hasta seis materiales diferentes incluyendo granos gruesos, granos finos, fertilizantes granulados, líquidos y amoníaco anhidro en distintas combinaciones
- **¡NUEVO!** Controle simultáneamente la dosis de aplicación de hasta dos productos diferentes con la pantalla CFX-750™
- El control de dosis variable de productos puede conseguirse con un mapa de prescripción VRA; o en tiempo real con un sistema GreenSeeker® para administrar eficazmente las necesidades de fertilizante de su lote
- El registro del área real tratada indica dónde se han aplicado insumos y automatiza los informes de registro
- Ajuste la población de semillas, las dosis de fertilizante o pulverización manualmente o usando una prescripción creada con el software de oficina Farm Works™
- Aplique una población alta en los suelos fértiles o bien irrigados para maximizar el potencial de rendimiento y reduzca la dosis en los suelos menos fértiles o menos regados

Optimice la operación de la plantadora y cree un entorno de alto rendimiento colocando las semillas con precisión. Evite costosos errores en la siembra monitoreando el rendimiento del indicador de semillas.

## MONITOREO DE SEMILLAS



- El monitoreo de semillas avanzado mejora la colocación de las semillas al enviar información de singulación del sistema de siembra al operador, lo que permite ajustar la plantadora mientras está trabajando
- **¡NUEVO!** La pantalla CFX-750 ya es compatible con el análisis de singulación y el monitoreo de semillas simple
- Evita costosos problema en la plantación al descubrirlos antes de que reduzcan el rendimiento
- Vea los resultados del análisis de singulación que incluyen información de población, singulación, saltos y superposiciones múltiples, espaciamento y calidad del espaciamento